

# CdS Thin Films Properties Prepared by Chemical Bath Deposition Techniques for Photoresists

강고루<sup>1,2</sup>, 윤주영<sup>2</sup>, 김진태<sup>2</sup>, 차덕준<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>군산대학교, <sup>2</sup>한국표준과학연구원

Chemical bath deposition (CBD) 기술에 의해 slide glass 기판 위에 CdS 박막을 적층 형성하였다. 적층된 박막들은 CdCl<sub>2</sub>와 thiorea (H<sub>2</sub>NCSNH<sub>2</sub>)를 증류수와 혼합 시dipping의 온도 조건, pH 조건, 시간 및 횟수를 달리하여 균일한 표면이 형성되도록 하였다. 적층된 박막은 200°C 이상의 고온에서 annealing하여 결정화하였다. 적층한 박막은 결정화 요인들을 XRD, FE-SEM, AFM, EDX, UV-Vis spectroscopy를 통해 조사하였다. 형성된 박막은 포토레지스터로 활용될 가능성을 조사하였다.

## Acknowledgement

본 연구는 "2012년도 산학연 공동기술개발 지역사업" 의 지원에 의해 수행되었습니다.

**Keywords:** CdS, CBD, Pyrolysis, Dipping methode